

株式会社ブイ・テクノロジー

第25回定時株主総会

2022年6月28日

第25回定時株主総会

【ご報告事項】

- 1. 第25期の事業報告、連結計算書類並びに会計監査人 及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2. 第25期計算書類報告の件

【決議事項】

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件



事業報告

1. 企業集団の現況について (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

事業環境

世界経済	・ウィズコロナが進み緩やかな回復傾向で推移 ・ウクライナ情勢、米国金融政策転換等による不透明感
米国	インフレと金融引締めによる景気の減速
中国	ゼロコロナ政策等の影響を受けた景気の減速
日本	新型コロナウイルス感染症の再拡大等の影響で減速

連結業績(百万円)

売上高	営業利益	経常利益	親会社株式に属する 当期純利益	受注高	受注残
51,418	5,461	5,868	4,198	53,200	42,721

(1)事業の経過および成果

①事業の概況(2/2) セグメント別

事業環境

事業セグメント	事業環境
FPD	大型FPDの設備投資が中国を中心に実施
半導体	世界的な半導体不足等を背景にシリコンウェハ関連の設備 投資等が堅調に推移

事業別業績(百万円)

事業セグメント	売上高	営業利益	受注高	受注残
FPD ()内は前期比増減	43,375 (▲ 9,566)	5,103 (▲1,649)	43,965 (+12,560)	36,093 (+582)
半導体 ()内は前期比増減	7,679 (+5,438)	553 (+551)	9,137 (+3,565)	6,627 (+1,200)



(1)事業の経過および成果

- ②設備投資の状況
- ③資金調達の状況

設備投資額:2,192百万円

>主な使途:横須賀イノベーションセンター新設等

資金調達:重要な資金調達無し



横須賀イノベーションセンター (2022年8月より稼働予定)



(2)重要な事業再編の状況

- ① 2021年6月: VETON TECH LIMITED株式の完全子会社化
- ② 同年6月に: Imec Agricultural Technology(Suzhou)Co. Ltd.設立
- ③ 2022年2月:株式会社アイテックを株式取得・完全子会社化

Imec Agricultural Technology



ブランドトマト「陽香」



蘇州市農場

株式会社アイテック



国内の金融・製造・流通等の幅広い業種に対応するエンベデッドシステムソリューション(装置用ソフトと関連)、オープンシステムソリューション及び、サーバー・ネットワーク用のインフラソリューションを提供



(3)財産および損益の状況の推移

企業集団の財産及び 損益の状況(1/3)

損益

コロナ感染再拡大に伴う、顧客との共同評価遅れ·部材納期遅延·顧客 都合による納期変更等により減収減益

	2021年3月期		2	2022年3月期	
(百万円)	金額	構成比	金額	構成比	増減率
売上高	55,186	100.0%	51,418	100.0%	▲ 6.8%
売上総利益	15,704	28.5%	15,486	30.1%	▲1.4%
営業利益	6,604	12.0%	5,461	10.6.%	▲17.3%
経常利益	6,836	12.4%	5,868	11.4%	▲14.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	3,513	6.4%	4,198	8.2%	+19.5%

(3)財産および損益の状況の推移

企業集団の財産及び 損益の状況(2/3)

総資産

総資産:前期比7,990百万円減少、72,601百万円

流動資産:「現金及び預金」等の減少により、63,085百万円(前期比8,294百万円減)

固定資産:「建設仮勘定の増加」等により、9,516百万円(前期比304百万円増)



(3)財産および損益の状況の推移

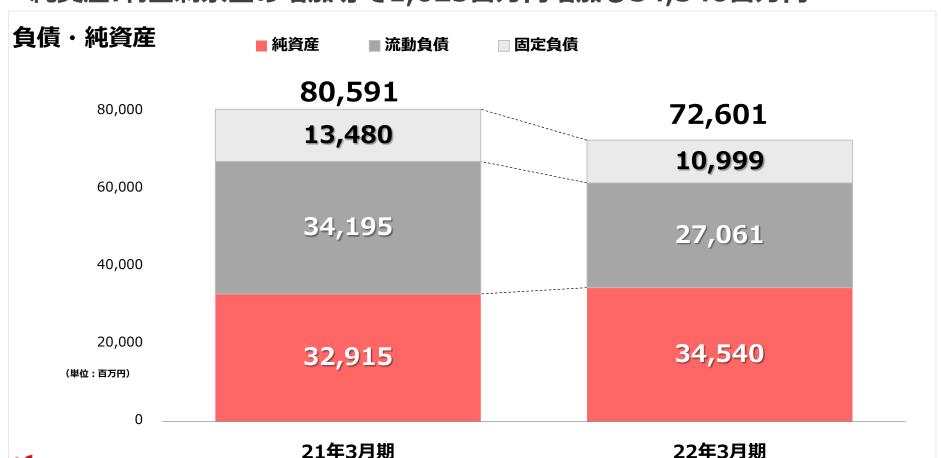
企業集団の財産及び 損益の状況(3/3)

負債・純資産

負債:前期比9,616百万円減少し38,060百万円

流動負債:「前受金」等の減少により27,061百万円(前期比7,134百万円減) 固定負債:「長期借入金」の減少により10,999百万円(前期比2,481百万円減)

純資産:利益剰余金の増加等で1,625百万円増加し34,540百万円



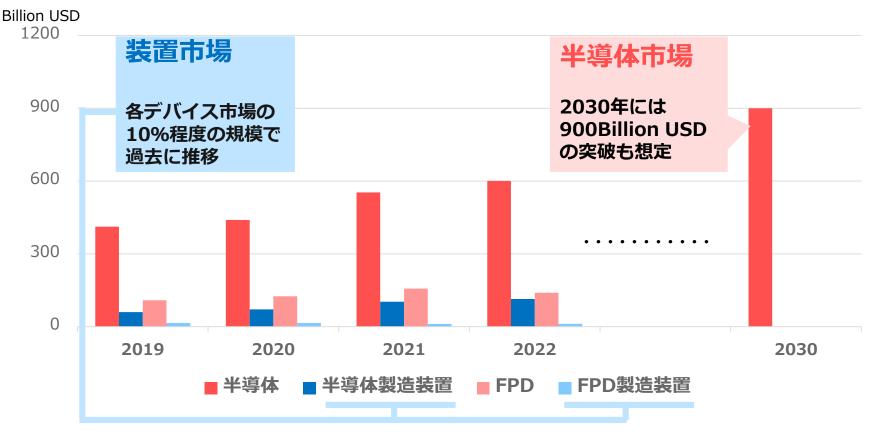
(4)親会社および子会社の状況

- ① 親会社の状況:該当なし
- ② 重要な子会社の状況: VETON社の株式の追加取得・完全子会社化

重要子会社一覧 V Technology Korea Co., Ltd. 資本金:598M WON/ 出資比 率:100% 株式会社ブイ・イー・ティー /主な業務:韓国における当社製品の受 資本金:490M JPY/ 出資比率:100% 注営業及びテクニカルサポート /主な業務:次世代蒸着マスクの製造 Kunshan V Technology Co., Ltd. 資本金:11.17M CNY/ 出資比率:100%/ 主な業務:中国における当社製品の受注 営業及びテクニカルサポート オー・エイチ・ティー株式会社 資本金:420M JPY/ 出資比率:100% /主な業務:各種電気検査装置の企 画・開発・製造・販売 **VETON TECH LIMITED** 資本金2.7M CNY/出資比率:100%/主 な業務:中国における当社製品の受注営 株式会社ナノシステムソリューションズ 業及び新規事業開拓 資本金:90M JPY/ 出資比率:100% V-TEC Co., Ltd. /主な業務:半導体製造装置、検査装置、 資本金:8.5M NTD/ 出資比率:100% 光学関連機器及び画像解析機器の開発・ /主な業務:台湾における当社製品の受 製造・販売 注営業及びテクニカルサポート

①経営環境

足元経済環境:ゼロコロナ政策・地政学的な問題・インフレ・金融引締め等の影響が懸念 半導体・FPD市場:技術進化と社会のデジタル化進展で中長期の成長継続



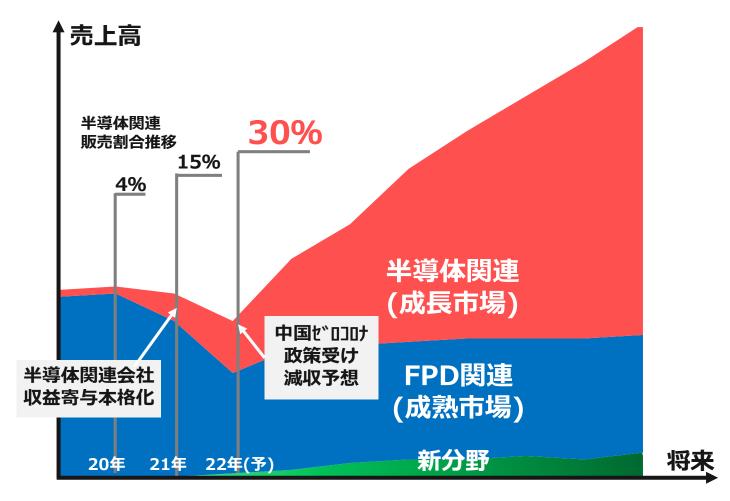
半導体・FPD関連市場推移

(2021年/WSTI、SEMI、OMDIA各社、経産省等の予測資料より当社にて作成)



収益構造の変革

- ① 半導体関連事業の成長加速
- ② 収益基盤であるFPD事業の安定化
- ③ 社会課題解決型ビジネスへ(新分野参入)





③主な取組み

半導体関連事業の成長加速(1/3)

2018年より半導体関連事業本格化

ビジネスネットワークやM&Aを駆使し、短い期間で事業を強化





③主な取組み

半導体関連事業の成長加速(2/3)

フォトレジスト

会社リソースのさらなる強化による収益の拡大

シリコンウェーハ

VTグループ加入後、NSS:子会社化後売上2.5倍/LTJ:子会社化後売上1.5倍に VTグループにある経営リソースを各社に投入し、製造・販売・新製品開発力をさらに強化

子会社名 NSS Z-CSET リソテックジャパン 研磨・研削 メモリーテスター レジスト評価システム しかったでロッパー レジスト評価システム

テスター

半導体関連	市場状況等	現在の製品・事業等	今後
シリコンウェー八等	・ 半導体需要増を背景とし 設備投資の増加	・検査装置(高シェア) ・国内外需要増	・子会社支援 ・イノベーションセンター(YRP)投資
	・ SiC/GaN市場拡大	・研磨・研削(実績増)	・中国顧客向け拡販
フォトレジスト	・ 中国半導体育成(非先端)・ 材料開発活発化(国内外)	・コータ・デベロッパー ・フォトレジスト分析	・中国顧客向け拡販(中国販社活用) ・増加する国内需要の取込
ICテスター	• 中国半導体産業育成	・イノテック社と協業	・中国顧客向けに拡販(Z-CSET) ・他用途の開拓検討

対象市場

③主な取組み

半導体関連事業の成長加速(3/3)

新製品開発の加速

VTコア技術×グループ会社の技術・事業=新製品開発加速、収益拡大を狙う

半導体関連	市場状況等	現在の製品・事業等	今後
フォトマスク (レガシー半導体)	・設備更新投資の増加 ・中国レガシー投資拡大	・欠陥修正・検査 ・レジストレーション	・高精度版の市場投入・検査装置の開発
		マスクライター	高精度マスクへの対応
半導体パッケージ	・微細化 ・部品需要増	・露光 ▶ ステッパー(評価機)	・ステッパー(量産機) ・ハイエンドDI
	・設備投資増加 		・EPISセンサー(回路電流可視化)

VTコア技術とグループ会社技術・事業領域とのシナジー

VTコア技術 グループ会社技術 新製品 顧客 ・光学設計 ・初号機評価 ・精密ステージ制御 >>露光 ・量産採用 ・光学設計 ≫加工 ・他工場展開 ・レーザー加工 ・画像処理 ・他 ・材料 >>フォトレシ スト解析 ステッパー(初号機評価中) ハイエンドDI 開発 ・ソフトウェア、他 協業 FPD分野 PKG分野 期間短縮 収益寄与

③主な取組み

収益基盤であるFPD事業の安定化

OLED/MiniLED/µLED関連装置:開発加速・採用拡大

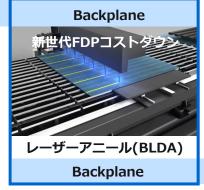
LCD関連装置:差別化開発加速・コストダウン・他プロセスへの採用拡大

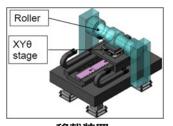
FPD	市場状況等	現在の製品・事業等	今後
OLED	・中型、大型用途の投資増	蒸着マスク	量産採用/マスクの大型基板対応
	・中国ゼロコロナ政策	蒸着装置	評価パートナー/評価機導入
		レーザーアニール	町個八一ドノー/町間級等八
		サルベージ	デムラIP新規採用拡大(ICメーカー)
MiniLED	・次世代LCDバックライト開発 ・大型パネル開発	LLO/移載	タクト・歩留まり改善機の投入
μ LE D		修正	検査技術の開発
		レーザーアニール ・パネル試作に成功	・中国顧客等に拡販・次世代バックライト・大型ディスプレイ・試作機の正式受注
LCD	安定的に推移	露光・検査 中国ゼロコロナ政策	・他プロセスへの採用拡大/差別化 ・左記政策で今期売上は前年比減を予想

蒸着マスク

OLED

蒸着装置(開発機)





移載装置 FD /Minit FD

LLO (Laser Lift Off) 修正 検査

その他の装置

µLED/MiniLED



③主な取組み新分野(農業等)

中長期の持続的なグループの成長には、海外市場中心の電子デバイス製造分野と異なる事業 領域で、国内市場をターゲットとした事業の立上げが不可欠

農業(ブランドトマト栽培)

ブランドトマトビジネス

- ・アイメック®農法
- ・ブランド名「陽香」
- ・蘇州にて栽培
- ・高糖度/高栄養価(リコピン他)
- ・中国ECで販売中



陽香

今後

- ・国内栽培
- ・農業経験を活用した技術開発、他





蘇州市農場

脱炭素(SiC技術への投資)

ネクスファイ・テクノロジー社へ資本参加

- 2021年6月設立
- · SiCデバイスを用いた高圧電源技術に強み
- ・ 国プロ支援/当社他VCにて出資

同社の今後

- ・ インフラ、遠距離送電用途開拓(高圧直流送電)
- ・ 半導体/FPD製造装置等の専用機用途開拓
- ・ EV/モーター検査関連用途開拓







高圧直流電源



第26期(2023年3月期)の連結業績および配当予想

連結業績予想	22年3月	期(実績)	23年3月]期予想	前期比
	金額(百万円)	構成比	金額(百万円)	構成比	増減率
売上高	51,418	_	45,000	_	▲12.5 %
営業利益	5,461	10.6%	4,500	10.0%	▲17.6%
経常利益	5,868	11.4%	4,400	9.8%	▲25.0%
親会社株主に帰属する当期純利益	4,198	8.2%	2,900	6.4%	▲30.9%
EPS	434.	21円	299.	92円	_

配当の状況	22年3月期	23年3月期
中間	60円(実績)	60円(予想)
期末	60円(計画)	60円(予想)



第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、将来の事業の拡大や経営基盤強化の為に必要な内部留保の充実を図りつつ、配当の安定性・継続性を考慮の上、経営成績に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。

上記基本方針および当期業績等を勘案し、期末配当金を下記の 通りとさせていただいております。

第25期 期末配当金: 1株につき金60円

効力が生じる日(支払日): 2022年6月29日(水)



第2号議案 定款一部変更の件

提案の理由:「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号) 附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行さ れることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなり ますので、次のとおり定款を変更するもの

- ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めること が義務付けられることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであ ります。
- ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付 を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定する ことができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するもので あります。
- ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。



第3号議案 取締役5名選任の件

取締役5名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。取締役 候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏 名 (生年月日)
1	すぎもと しげと 杉本 重人 (1958年7月9日)
2	てんにち かずひと 天日 和仁 (1959年8月22日)
3	かんざわ ゆきひろ 神澤 幸宏 (1962年10月17日)
4 【社外】	きど じゅんじ 城戸 淳二 (1959年2月11日)
5 【社外】	にしむら ひでと 西村 豪人 (1953年7月14日)

株式会社ブイ・テクノロジー 第25回定時株主総会にご出席頂き、 ありがとうございました。

